PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-125343

(43) Date of publication of application: 28.05.1991

(51)Int.CI.

G11B 7/24

(21)Application number: 01-263046

(71)Applicant: ASAHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

11.10.1989

(72)Inventor: SUZUKI MASARU

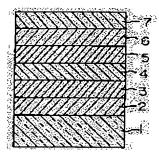
MORIMOTO ISAO **FURUYA KAZUYUKI** KOBAYASHI MITSURU

(54) OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve repeatability of a medium for overwriting by selecting one element from the group IVa and group VIa in the periodical table or one compd. of those elements for an adhesion layer of the optical recording layer.

CONSTITUTION: On a transparent substrate, there are successively formed a lower protective layer 2, lower adhesion layer 3, optical recording layer 4, upper adhesion layer 5, upper protective layer 6, and UV curing resin layer 7. The adhesion layer consists of one element selected from the group IVa or group VIa in the periodical table or one compd. of these elements. By this constitution, deterioration of characteristics due to material transfer in the optical recording layer 4 can be prevented when overwriting is repeated, and thus, repeatability of the medium can be improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

@公開特許公報(A) 平3-125343

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

③公開 平成3年(1991)5月28日

7/24 G 11 B

8120-5D В

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

光学情報記録媒体 60発明の名称

> 願 平1-263046 创特

> > 充

顧 平1(1989)10月11日 22出

勝 木 者 鈴 @発 明 本 勲 森 者 @発 明 之 古 谷 @発 明 者

旭化成工業株式会社内 静岡県富士市鮫島2番地の1

旭化成工業株式会社内 静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内 静岡県富士市鮫島2番地の1

小 旭化成工業株式会社 勿出 顋

者

明

林

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

明

1. 発明の名称

冗発

光学情報記録媒体

- 特許請求の範囲
 - (1) 透明基板上に光学記録層を設け、該光学記録 層にエネルギービームを照射することによりそ の光学定数を変化させ情報を記録および消去す る光学情報記録媒体において、該光学記録層の 両側もしくは一方に光学記録層に接して密着層 を設け、該密着層が周期律表第IVa族および第 VIa族の元素およびその化合物から選択された 少なくとも一種から成ることを特徴とする光学 情報記錄媒体。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、新規な光学情報記録媒体、詳しくは、 光や熱などを用いて光学的に情報を高速かつ高密 度に記録、再生、消去することができる繰り返し 特性の優れた光学情報記録媒体に関するものであ る。

従来の技術

に相変化することを利用して情報の記録・消去を 行ういわゆる相変化型光ディスクは、レーザー光 のパワーを変化させるだけで古い情報を消去しな がら同時に新たな情報を記録する(以下"オーパ ーライト"という。) ことが出来るという利点を 有している。このオーバーライト可能な相変化型 光ディスクの記録材料としては、In-Se系合金 (Appl. Phys. Lett. 第50巻、667ページ、 1987年)やIn-Sb-Te(Appl. Phys. Lett. 第50 巻、 1 6 ページ、 1 9 8 7 年)、Ge-Te-Sb合金等 のカルコゲン合金が主として用いられている。一 方これらカルコゲン合金を用いて実際に記録・消 去を行う場合、記録・消去時の熱による基板の変 形を防止したり、光学記録層の酸化あるいは変形 を防止するために、通常該光学記録層の両側もし くは一方に金属あるいは半金属の酸化物、炭化物、 フッ化物、硫化物、窒化物あるいはこれらの混合 物から成る保護層を設ける。中でも光学記録層に

光学記録層が、結晶質と非晶質との間で可逆的

カルコゲン合金を用いる場合は、2gSが安定性及 ・び繰り返し上好ましい。

ところが、従来の保護圏を用いる限りオーバーライトにより記録・消去を繰り返すと光学記録層物質の溶融時における物質移動が起こり、遂には局部的に光学記録層物質が周囲に分散してしまい記録・消去が不可能になってしまうという問題点がある。

発明が解決しようとする課題

本発明は上記問題点をなくし、オーバーライト における繰り返し特性の優れた相変化型光ディス クを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

本発明者らは、上述の目的を違成すべく鋭意検討した結果、光学記録層材料のカルコゲン合金と密着力の高い材料は、周期律表第IVa族およびその化合物であることを見いだし、本発明に至った。即ち本発明は、光学記録層が周期もしくは一方に密着層を設け、該密着層が周期律表の第IVa族の元素およびその

化合物から選択された少なくとも一種から成ることを特徴とする光学情報記録媒体を提供するものである。

密着層材料としては、周期律表第IV a 族 および 第 VI a 族の元素 およびそれらの化合物、例えば、 Ti, Zr, Hf, Cr, Mo, W, TiO1, ZrO2, HfO2, CrO2, MoO1, WO2, TiC, ZrC, HfC, Cr2C2, WC, TiB1, ZrB1, MoB2, CrB2, TiN, ZrN, HfN, TiS, ZrS, HfS等の材料が好ましいが特に,

上記光学情報記録媒体における保護層として、 高融点で適当な熱伝導率をもち耐水性に優れてい るものであればよい。例えば、SiO2, Al,O3, ZrO2, Ta2O3, Si3N4, AlN, ZnS, SiCなどの材料及びそれら の混合物を用いることができるが、密着層との密 着力が強いことから特にZnSが好ましい。

また、上記密着層及び保護層の形成方法として、 スパッタリング法や真空蒸着法(抵抗加熱、電子 ビーム)あるいは、CVD法等の方法を用いることが出来る。

さらに光学記録層としては、Sb-Te-Ge, In-Sb-Te, In-Se-T!等の合金が好ましく、これらの形成方法としては、スパッタリング法や真空蒸着法等の公知の方法を用いることが出来る。

光学情報記録媒体における透明基板としては、 従来光ディスクの基板として慣用されているもの を用いることができるが、光学的特性が良好で機 械的強度が大きく、かつ寸法安定性に優れるポリ カーボネート、ガラスなどが好適である。また、 これらの透明基板にはアドレス情報などの凹凸が 形成されていてもよい。

本発明によれば、光学記録層の両側もしくは一方に、周期律表第IVa族および第VIa族の元素およびをO化合物から選択された少なくとも一種から成る密着層を設けることによってオーバーライトの繰り返しにおいて、光学記録層の物質移動による特性の劣化を防止することが可能となり、繰り返し特性を大福に向上させることができる。

以下本発明を実施例により詳細に説明する。 実施例

実施例!

厚さ1.2 ㎜のポリカーボネート基板上に、スパ ッタ法を用いて、下層保護層、下層密着層、光学 記録層、上層密着層、上層保護層の順に積層した。 保護層材料としてはZnSを、光学記録層材料とし てはSb-Te-Ge系合金を用いた。密籍層材料として は、周期律表第Na族からTiを、第VIa族からCr. Moを用いた。各届の膜厚は、基板側から順に、 100 nm, 10 nm, 80 nm, 10 nm および 150 nmとした。つぎにこの上に、UV硬化樹脂を 5 μ m塗布しUVで硬化させた。このようにして用意 された基板を静止した状態でレーザー光を照射す ることにより繰り返し特性を評価した。レーザー 光の波長は 8・3 0 nmである。評価はレーザー光 の発光時間を20n secから60μ secまで、レー ザー光のパワーは、 1 mWから 2 0 mWまでの範囲内 で任意に変えることにより行った。その結果を第 2図に示す。ここで密着層なしというのは、密着

実施例2

厚さ1.2 mのボリカーボネート基板上に、実施例1と同様の層構成を持つ光学情報記録媒体を作製した。但し、密著層材料としてCr.0.を用いた。評価方法は実施例1と同じく基板を静止した状態で行った。その結果を第3図に示す。特性比較のため実施例1で示した密着層なしも併せて示した。Cr.0.よりなる密着層を用いた場合もCr.のみ使用した場合と同様、記録状態の反射率及び消去状態

の反射率ともに変化なく、化合物として用いても 同様の効果が得られる。

実施例3

以下 余白

第1表

付着層 (Cr)の膜厚 (nm)	記録感度 (元甲)
0	14
5	15
10	16
30	17
50	i 8
100	22

第1表より明らかなごとく、密着層の膜厚が厚くなるともに記録感度が低下し、での膜層の膜厚が多く、でのではえると記録レーザーが20回以上が多点をは50nm以下が良い。上記層構成のオードのでは50nm以上あれば、10°回までC/N比の変化がなく、0nmの層構成に比べて約10倍繰り返し特性が向上した。また他の材料を用いた場合も同様の結果が得られた。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明による光学情報記録媒体の履 構成の1例を示す図であり、図中符号1は透明基 板、2は下層保護層、3は下層密着層、4は光学 記録層、5は上層密着層、6は上層保護層、7は UV硬化樹脂層である。第2図は、実施例1で、 静的に繰り返し特性を評価した例を示す特性図で ある。第3図は、実施例2で静的に繰り返し特性 を評価した例を示す特性図である。

特許出願人 旭化成工粜株式会社

第 | 図

